文章编号: 1001-3806(2012) 03-0382-04

可见光下3维针孔的衍射波面分析

王瑞林¹²,邢廷文^{1*},谢伟民¹

(1. 中国科学院 光电技术研究所 成都 610209; 2. 中国科学院 研究生院,北京 100039)

摘要:针孔是相移点衍射干涉仪中的关键元件。为了探究针孔的尺寸、制造针孔的材料以及材料的厚度对衍射波 面质量的影响 确定点衍射干涉仪的测量精度 采用时域有限差分法分析获得了近场数据,并利用瑞利-索末菲矢量衍射 理论将近场数据外推得到远场数据 通过远场处理数据分别对 TM 和 TE 偏振光入射针孔时 ,针孔的大小、材料以及材料 厚度对衍射波波面质量的影响进行了理论分析和仿真模拟 ,得到了相应变化曲线图。结果表明 ,若要获得理想的球面 波 材料厚度不能低于 300nm ,适当的孔径尺寸可以降低衍射波面误差;当孔径为 300nm 左右时 ,波面的均方根误差可达 到 λ/1000(λ = 632.8nm)。这一结果对相移点衍射干涉仪的设计和应用是有帮助的。

关键词:物理光学; 衍射波面; 时域有限差分法; 矢量衍射理论

中图分类号: 0436.1; TN247 文献标识码: A

doi: 10. 3969/j. issn. 1001 3806. 2012. 03. 025

Analysis of diffractive wave-front of 3-D pinhole under visible light

WANG Rui-lin^{1 2}, XING Ting-wen¹, XIE Wei-min¹

(1. Institute of Optics and Electronics Chinese Academy of Sciences Chengen 610209, China; 2. Graduate University, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China)

Abstract: A pinhole is one of the key components in a phase shifting point diffraction interferometer (PS-PDI). In order to study the effect of the size of pinhole , material of pinhole and thickness of material on the quality of diffraction wave-front , and determine the measurement accuracy of the PS-PDI , near-field data was obtained by means of the finite-difference time-domain method , and then the data of far field based on Rayleigh-Sommerfeld vector diffraction theory could be acquired from near field data. The quality of diffractive wave-front was analyzed under the uniform incident light with TE and TM polarization , and the corresponding curve was achieved. The results show that in order to obtain perfect wave-front , the thickness of material should not be less than 300nm. Appropriate aperture size can reduce the error of wave-front. When the size of pinhole is 300nm , the root mean square wave-front error is below $\lambda/1000$ ($\lambda = 632.8$ nm). It is of great help to design and application of a PS-PDI.

Key words: physical optics: diffractive wave-front; finite difference time domain; vector diffraction theory

引 言

随着光学加工精度的提高,对光学检测技术提出 了更高的要求。现有干涉仪主要采用标准透镜作为参 考,这对高精度检测有了一定的限制。为了克服这种 困难,点衍射干涉仪的出现解决了这一难题。

点衍射干涉仪是^[1] 在 1972 年由 SMARTT 和 STRONG 发明的,主要是采用针孔产生接近理想的衍 射波前,与被检波前干涉形成条纹,以检测被检波面的 质量。因此,如果小孔加工精度不够,就会限制干涉仪 的检测精度。要想制造出满足要求的针孔,就需要对 小孔的加工误差以及小孔的自身误差进行严格的仿真

和分析^[2-4]。

MA 等人研究了标量情况的衍射波面误差^[5],但 是传统的标量衍射理论在针孔尺寸接近光波波长时不 再适用,因此,必须采取严格的矢量衍射理论进行分 析。LAI 等人对圆孔衍射的衍射波能量进行了分 析^[6]。LU 等人采用矢量理论对极紫外波段下的 3 维 小孔进行了分析^[7]。作者主要采用时域有限差分(finite difference time domain, FDTD)的方法^[840],并用矢 量衍射理论完成近场到远场的推算过程^[11],然后对远 场波面进行 Zernike 拟合^[1244]。

1 FDTD 法的基本原理

电磁场的传播问题可以通过麦克斯韦方程组进行 严格计算。麦克斯韦方程组可以写成积分形式,也可 以写成微分形式。FDTD 法就是由微分形式的麦克斯 韦旋度方程进行差分离散得到时域推进的公式^[7]。 FDTD 算法最典型的模型就是如图 1 所示的 Yee 元

作者简介: 王瑞林(1986-), 男,硕士研究生,从事光学检测方面的研究。

^{*} 通讯联系人。E-mail: xingtw@ioe.ac.cn 收稿日期:2011-10-14;收到修改稿日期:2011-11-08

胞。Yee 元胞是一个棱长(空间步长)为*l*的立方体。 图1中表示出在一个元胞内,电磁场的电矢量和磁矢 量在各个节点的排布情况,这种空间排布满足法拉第 感应定律和安培环路定律,进而通过求解麦克斯韦方 程组的差分方程求出电磁场的分布情况。并且,电场 和磁场在时间顺序是交替抽样,彼此之间相差半个时 间步长,从而可以在时间上迭代求解电磁场的分布。





在直角坐标系中,结合介质中的物质方程麦克斯 韦方程组表示成微分形式:

$$\begin{cases} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} + \sigma E_x \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} + \sigma E_y \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + \sigma E_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} - \sigma_{\rm m} H_x \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} - \sigma_{\rm m} H_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} - \sigma_{\rm m} H_z \end{cases}$$

$$(2)$$

式中 $E_x E_y$ 和 E_z 分别表示电场的 x y和 z分量; H_x , H_y 和 H_z 分别表示磁场的 x y和 z分量; $\varepsilon \mu$ 分别称为 介电常数和磁导常数 σ 是电导率 σ_m 是磁导率。

FDTD 中表示对麦克斯韦方程组的差分离散基本 思想为: 在直角坐标系中的 6 个方程沿 3 个坐标轴划 分很多网格单元,每个单元长度作为空间变量 相应地 得出时间变量,用有限差分式表示关于场分量对空间 和时间变量的微分。用 $\Delta x \Delta y$ 和 Δz 表示单元沿 3 个 轴向的长度 Δt 表示时间增量。网格的顶点坐标可记 为: (*i j k*) = (*i* $\Delta x j\Delta y k\Delta z$),任一空间和时间的函数 可表示为:

 $F_n(i j k) = F(i\Delta x j\Delta y k\Delta z n\Delta t)$ (3) 式中 *n* 表时间步长。任一点对时间和空间的有限差 分可表示为:

$$\begin{cases} \frac{\partial F_n(i j k)}{\partial x} = \frac{F_n\left(i + \frac{1}{2} j k\right) - F_n\left(i - \frac{1}{2} j k\right)}{\Delta x} \\ \frac{\partial F_n(i j k)}{\partial t} = \frac{F_{n+1/2}(i j k) - F_{n-1/2}(i j k)}{\Delta t} \end{cases}$$
(4)

2 仿真分析方法及模型

模型建立如图 2 所示。图中,1 为玻璃平板 2 为 针孔材料 3 为针孔 A 为针孔在远场的衍射波前。入 射光波经玻璃平板后 在针孔处发生衍射,形成近场光 波,然后根据矢量瑞利-索莫非衍射理论,将近场光波 外推到远场,形成远场波前,进而进行误差分析。



Fig. 2 Model of pinhole diffraction

算法流程主要分为 3 步。第 1 步,设置入射光波 类型、针孔大小和材料,并用 FDTD 法计算针孔衍射的 近场数据;第 2 步,将近场数据用矢量瑞利-索莫非衍 射理论外推到远场;第 3 步,对远场波面进行 Zernike 拟合,并去除波面的平移、倾斜和离焦,然后计算衍射 波面误差的峰谷(peak-to-valley, PV) 值和均方根(root mean square ,RMS) 值。

模型中主要采用可见光(λ = 632.8nm),分别计算 当 TM 波、TE 波入射不同针孔尺寸、材料和材料厚度 的针孔时,衍射波波面误差的 PV 值和 RMS 值。

3 仿真结果分析

3.1 针孔尺寸对衍射波质量的影响

针孔的尺寸严重影响衍射波面的质量,当孔径较 大时,可以采用标量衍射理论近似计算,当孔径过小 时,必须使用矢量衍射理论进行严格分析。这里分别 计算孔径直径尺寸从 50nm 到 800nm,步长为 50nm 的 衍射波波面质量。图 3a 和图 3b 分别表示不同直径针 孔与衍射波面误差的 PV 值和 RMS 值的关系。从图 中可知:球面误差不随孔径单调变化,当孔径较小时, 误差随孔径的减小逐渐增大,这和孔径的传播模式有 关; TM 偏振和 TE 偏振的 RMS 值大致相同。从图 3a 中可以看出,当数值孔径 $d_{\rm NA} = 0.4$ 时,孔径直径在 300nm 左右, PV 值能取得最小值。当 $d_{\rm NA} = 0.2$ 时,PV 值能达到 $\lambda/100$,且对于 TE 和 TM 模式最低点有轻微 的差别。在图 3b 中可以看出, $d_{\rm NA}$ 减小时,RMS 值减



Fig. 3 a—relation between wave-front error PV and aperture size b—relation between wave-front error RMS and aperture size

小 但总体变化趋势大致相同,对于 TE 和 TM 两种模式 在针孔直径很小时,两者几乎相同;当直径增到 500nm 左右时,两种模式的 RMS 值会出现微小变化 当 *d*_{NA} = 0.4 时,RMS 最小可达到 0.000254λ。

由图 3 的曲线可知,理论上,孔径越小衍射波的波 面误差应该越小,但是实际的计算结果不是单调变化, 这是由于当孔径非常小时,针孔除了起到滤波的作用 外,还具有光波导的作用,因此,随着孔径逐渐减小,衍 射波面误差增大。随着孔径的增大,针孔能够传播的 模式增多,因此,孔径较小时,开,波和 TM 波的衍射波 面大致相同,当孔径增大时,衍射波面的误差会出现微 小的变化。

3.2 针孔材料厚度对衍射波质量的影响

针孔材料厚度对衍射波波面的质量也起着至关重 要的作用。理论上分析 材料厚度过小 将会有光透过 并发生干涉,从而增加衍射波面的误差;厚度过大,会 使得衍射波光强度降低。因此,选取适当的材料厚度 对获取理想球面波也有一定的帮助。由于计算量过 大,本文中仅选取了材料厚度从 30nm 到 400nm 之间 的变化仿真。图 4a 和图 4b 中分别给出孔径直径为 300nm 时不同材料厚度的衍射波面误差的 PV 值和 RMS 值。结果表明,随着数值孔径的降低,衍射波面 的误差曲线变化较大。对于 TM 偏振和 TE 偏振的光 波,衍射波波面误差的 PV 值变化不大, RMS 值基本一 致。由图 4a 可以看出: 当 d_{NA} = 0.4 时,衍射波面误差 的 PV 值随材料厚度的变化不是很明显; 当 d_{NA} = 0.2、



hg. 中 a beam Pietween wave-front error RMS and thickness of material b relation between wave-front error RMS and thickness of material 材料厚度在 300nm 左右时,衍射波面误差 PV 值随着 厚度的增加而下降。由图 4b 可知:衍射波面误差的 RMS 值随材料厚度的增加逐渐减小,但变化趋势不是 很大。由仿真结果可以看出,当材料厚度为 300nm 以 上时,衍射波波面误差 RMS 较小,PV 变化不大。因 此,要想获得较为理想的球面波,材料的厚度应控制在 300nm 以上。

不同的数值孔径计算的结果变化曲线有所不同, 可见当使用衍射波面的大数值孔径时,基底材料厚度 对衍射波面的影响不是很大,如果使用衍射波面的很 小一部分,不同的厚度就会产生不一样的波面误差。 可以看出,在孔径对衍射波面影响的计算中,当孔径在 300nm 左右时,对于 TE 和 TM 入射波而言,衍射波面 的误差几乎完全一样,只有当孔径增大到一定程度时, 两种振动模式的衍射波面才会出现差异。同时也说明 在孔径为 300nm 左右时,入射光偏振态的变化对衍射 波的波面质量影响不大。由于针孔直径在 300nm 左 右时,衍射波面误差出现最小值,故本节中只计算了此 时材料厚度对衍射波波面质量的影响。针孔孔径和材 料厚度同时作用时对衍射波的影响仍需进一步仿真 计算。

3.3 针孔制作材料类型对衍射波质量的影响

不同材料制作的小孔衍射波的波面质量变化也较 大 选择合适的材料既能改善针孔的加工误差,又能降 低针孔衍射波的波面误差。仿真模型中分别选取绝缘 体(氟化锂(LiF)、氯化钠(NaCl)),半导体(锗(Ge)、 磷化镓(GaP)、砷化镓(GaAs))和导体(铝(Al)、铜 (Cu)、完美电导体(perfect electric conductor PEC))介 质 针对不同的介质材料计算衍射波波面误差的 PV 值和 RMS 值。图 5a 和图 5b 中给出这几种材料在厚 度为 300nm、针孔直径在 300nm 时衍射波波面误差 的 PV 值和 RMS 值。结果表明,不同类型的材料由 于其介电常数不同,电磁波在这些材料制成的针孔 中衍射时就会产生不同的偏差。对于绝缘体材料, 衍射波的波面误差较大;对于半导体材料,衍射波波 面误差对于不同的材料变化不大;对于金属材料,不 同的材料衍射波波面变化较大。图 5a 中可以看出, 当 $d_{NA} = 0.4$ 时 除金属铝外 其余材料衍射波波面的 误差 PV 值对于 TE 和 TM 两种模式基本相同; 当 $d_{NA} = 0.2$ 时,半导体材料 GaP 的 PV 误差对于两种模 式变化较大。由图 5b 中可知,金属材料的衍射波波 面误差 RMS 值最小 其中 PEC 材料的衍射波波面误 差 PV 值可达到 0.0026λ。



Fig. 5 a—relation between wave-front error PV and variou material of pinhole b—relation between wave-front error RMS and various material of pinhole

4 结 论

基于 FDTD 算法的矢量衍射理论,分别分析了可 见光($\lambda = 632.8$ nm)下 TE 偏振和 TM 偏振入射针孔时 衍射波的波面质量,针对针孔尺寸、材料厚度和材料种 类建立了仿真模型。仿真模型中使用的材料均为半导 体材料。分析结果可知,要想得到较为理想的球面波, 针孔的尺寸应控制在 300nm 左右,厚度不应小于 150nm,此时对于数值孔径为0.2的衍射波,波面误差 RMS可接近λ/1000。对于不同类型的材料,衍射波面 误差差异较大,不宜选择绝缘介质作为针孔制作的材 料,可以选择金属材料作为制作材料,例如对于光波入 射时可以看作完美电导体的材料。本文中对针孔衍射 主要采用的是半导体材料,对于金属材料的针孔,需对 特定的材料进行进一步的分析计算。

参考文献

- SMARTT R N , STRONG J. Point diffraction interferometer [J]. Journal of the Optical Society of America 1972 62: 737-742.
- [2] OTAKI K , ZHU Y , ISHII M, et al. Rigorous wavefront analysis of the visible-light point diffraction interferometer for EUVL [J]. Proceedings of SPIE , 2004, 5193: 182–190.
- [3] GAO F, JIANG Z D, CI B, Diffraction wavefront analysis of point diffraction interferometer for measurement of aspherical surface [J]. Proceedings of SPIE /2010 7656: 1-8.
- [4] TSOY V. MELNIKOV L A. Diffraction by extremely small holes in thin absorbing and transparent screens and by disks [J]. Optics Comnumications 2008 281(8): 1935-1940.

MA Q , LIU W Q , LI X B , et al. Analysis of diffraction wavefront ertor in point diffraction interferometer [J]. Acta Optica Sinica ,2008 , 28(12):2321-2324(in Chinese).

- J LAI Ch W, DENG X J, WANG G A, et al. Energy transmission of nonparaxial vector diffraction beam [J]. Laser Technology, 2009, 33 (4): 446-448(in Chinese).
- [7] LU Z X , JIN C S , ZHANG L C , et al. Wavefront quality analysis of three dimension pinhole vector diffractional in extreme ultraviolet region [J]. Acta Optica Sinica ,2010 ,30 (10) : 2849-2854 (in Chinese).
- [8] GE D B , YAN Y B. Finite difference time domain method for electromagnetic wave [M]. Xi' an: Xi' an University Press 2005: 11-34(in Chinese).
- [9] JUN S Y, ATSUSHI Y, TAKANORI M, et al. A finite-difference time-domain beam-propagation method for TE and TM wave analyses [J]. Journal of Lightwave Technology 2003 21(7):1709-1715.
- [10] MASOUDI H M , ALSUNAIDI M A , ARNOID J M. Time-domain finite-difference beam propagation method [J]. Photonics Technology Letters ,1999 ,11(10):1274-1276.
- [11] JOHN D J. Classical electrodynamics [M]. Beijing: People's Education Press ,1978:481-500(in Chinese).
- [12] YANG J W, HUANG Q L, HAN Y M. Application and simulation in fitting optical surface with Zernike polynomial [J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing 2010 31(5):49-55(in Chinese).
- [13] ZHANG W, LIU J F, LONG F N, et al. Study on wavefront fitting using Zernike polynomials [J]. Optical Technique ,2005 ,31 (5): 675-678(in Chinese).
- [14] HUI M, NIU H B. A method of wavefront data fitting using Zernike polynomials[J]. Acta Optica Sinica ,1999 ,28(12):1113-1116(in Chinese).